



光鎳 Ni-2

§產品說明

Ni-2 光鎳專用於印刷電路板光澤性鍍鎳制程，焊錫性佳，鍍層光澤性良好，對不純物容忍範圍寬闊，操作容易，減除針孔困擾。

§槽液配置

	最適值	範圍
鎳離子	75 克/升	60-90
胺基磺酸鎳 410 毫升/升或硫酸鎳 350 克/升		
氯化鎳	30 克/升	10-50
硼酸	40 克/升	30-50
Ni-2B 光澤劑	1 毫升/升	1-5
Ni-2C 柔軟劑	30 毫升/升	20-40
Ni-2W 濕潤劑	2 毫升/升	1-10

§操作條件

	最適值	範圍
溫度	50°C	50-60
PH 值	4.2	4.0-4.5
電流密度	2 安培/平方公寸	0.5-6
陰陽極面積比	1:2	
攪拌	擺動，過濾循環，及無油無塵的空氣攪拌	
加熱器	石英，不鏽鋼或鐵氟龍	



§維護與控制

1、操作法

每處理 100 安培小時, 補充 Ni-2B 25 毫升, Ni-2C 250 毫升。

2、分析法

①光澤劑以哈氏槽實驗或 CVS 分析後添加校正。

②其他含量, 依分析添加。

3、推薦採用胺基磺酸鎳, 比重 1.54, 鎳含量 180 克/升。

4、如有針孔發生時, 可添加潤濕劑 Ni-2W 1-5 毫升/升。